

自然科学研究機構分子科学研究所極端紫外光研究施設 X線磁気円二色性測定装置（XMCD）有償利用要項

平成24年11月27日
分子科学研究所長決定

（趣旨）

第1 この要項は、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業（以下「ナノプラットフォーム事業」という。）の一環として自然科学研究機構分子科学研究所（以下「研究所」という。）で管理する装置の有償利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第2 この要項において「装置の有償利用」とは、研究所の装置を利用する者（以下「利用者」という。）が次の各号に掲げる装置を有償で利用することをいう。

- 一 X線磁気円二色性測定装置（XMCD）

（申請）

第3 利用者は、あらかじめ別記様式第1号又は第2号による申請書を分子科学研究所長（以下「研究所長」という。）に提出しなければならない。

（許可）

第4 研究所長は、前条による申請書の提出があった場合は、極端紫外光研究施設長の意見を聴き、相当と認めたときは、別記様式第3号により利用を許可するものとする。

（報告書）

第5 利用者は、装置の利用を終了又は中止したときは、成果公開の場合は、研究所の指定する期日までに別に定める様式による報告書を、成果非公開の場合は、その終了の日から1月以内に別記様式第4号による報告書を研究所長に提出しなければならない。

（知的財産権の取扱い）

第6 利用者が、装置を利用して得られた研究成果による発明等に係る知的財産権（「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権、ノウハウ及びその他一切の知的財産権をいう。）の取扱いは、大学共同利用機関法人自然科学研究機構職務発明等規程（平成16年自機規程第12号）に定めるところによる。

（使用料）

第7 利用者は、別に定めるところにより装置の使用料を納付しなければならない。

（遵守事項）

第8 利用者は、研究所の規則、関係法令及び指示等を遵守するとともに安全の確保に努めなければならない。

（損害賠償）

第9 利用者は、故意又は重大な過失により、研究所の施設・設備等を滅失又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10 この要項の実施に関し必要な事項は、極端紫外光研究施設長が別に定める。

附 則

この要項は、平成24年11月27日から施行する。

附 則

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

別記様式第1号

整理番号	
------	--

極端紫外光研究施設XMC D利用申請書（成果公開用）

平成 年 月 日

分子科学研究所長 殿

申請者 所属先
 所属 住所(〒)
 職名 電話 (内線)
 ふりがな E-mail
 氏名 印 企業種別(*) 大企業 / 中小企業 / その他
 分野・業種等(*)
 *...下段の基準及び一覧選択すること

下記のとおり貴研究所の装置を有償利用したいので申請します。
 また、実施に当たって、万一の傷害等の保障に関しては、申請者と申請者の所属機関においてすべての責任を負えることを誓約します。

記

1. 課題名 :
2. 利用希望ビームライン及び吸収元素・吸収端 :
 XMCD (BL4B) 吸収元素・吸収端 : ~
3. 申請者及び共同利用研究者 : (1日単位でご記入ください。例 : 3日、6日)

番号	氏名	所属・職名	備考
申請者			
2			
3			
4			
5			

(5名以上の場合は、同様式で記入し、添付してください。その際、役割分担についても記述願います。)

4. 申請区分 (該当するものに○) : 前期 (4月~9月) ・後期 (10月~3月)
5. 希望マシンタイム : マルチバンチ () 日, シングルバンチ () 日
 XMCD装置は、火~金の4日間 (最大60時間) です。
 シングルバンチを必要とする場合は、その理由 :

6. 実施期間

第1希望 :	平成	年	月	日	~	平成	年	月	日
第2希望 :	平成	年	月	日	~	平成	年	月	日
第3希望 :	平成	年	月	日	~	平成	年	月	日

7. 希望実施期間以外に、どうしても不都合な期間がある場合にのみお書きください。

不都合な時期：平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

8. 測定試料^(注)：.....(気体・液体・固体).....

9. 研究目的、研究内容及び実施計画

下記 a)~e) 各項目についてA4 2ページ程度に入る様に記述し、添付してください。

a) 研究の意義づけや独創性 (課題審査では、学術的重要性、UVSOR利用の妥当性、過去の論文発表状況を総合的に評価します。)

b) 今回の研究内容の具体的説明 (継続中の課題や以前に類似の課題申請がある場合、前回からの進捗状況や相違点を必ず明記。)

c) 実施計画と実験条件の詳細

d) 利用日数の見積り

e) 申請者が出版した本研究に関連する論文やActivity Reportのリスト

なお、技術的な問題については、予めビームライン担当者と相談してください。

10. 液体ヘリウムの利用の有無

有 (日/日× 日) 無

11. 機器の利用希望： 有 無

ビームラインに常設の機器以外のものを希望する場合は、ビームライン担当者に確認してから記入してください。(チェンバー、クライオスタット、排気系などを含む。)

持込み機器の名称

12. 機器センター機器の利用希望

機器名 ミクロム FIB その他 ()

(注) 「放射線業務従事承認書」及び「実験試料・化学薬品の使用届」の提出を忘れないこと。

また、来所の際には、「実験試料・化学薬品の使用届」の写しを持参すること。

13. 不正防止に関する誓約

申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、以下のガイドライン等を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令等を遵守し、研究活動における特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)、及びそれ以外の不正行為(不適切なオーサーシップ、二重投稿等)を行いません。

(1) 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン

(平成26年8月26日文科科学大臣決定)

(2) 大学共同利用機関法人自然科学研究機構研究活動上の不正行為を防止するための基本方針

(平成20年2月28日決定)

(3) 大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規程

(平成20年2月28日自機規程第74号)

以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。

誓約します。

14. 安全管理に関する誓約

申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、分子科学研究所安全ガイド (<https://www.ims.ac.jp/guide/safetyguide.pdf>) を理解し、これらのガイドライン、自身が所属する機関の規則、労働安全衛生法等の関連する法令等を遵守し、安全と環境を常に意識しながら、研究活動における事故・災害の発生防止に努めます。

以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。

誓約します。

上記の装置利用の申込みを承認する。

所 属：

職 名：

氏 名：

印

上記は、申請者が本研究所に来所し実験等を行うことを承認できる方の所属、職名及び氏名(申請者本人は不可)を記入の上、捺印ください。

記載不要

施設長	担当者

【企業種別基準】

大企業 資本金3億円以上または従業員300人以上のどちらかに該当するもの

中小企業 資本金3億円以上または従業員300人以上のどちらにも該当しないもの

その他 上記に該当しないもの

【分野・業種等一覧】

1 有機材料／2 電子・磁性・金属・無機材料／3 繊維・窯業・紙・パルプ／4 食品・飲料／
5 化粧品・トイレタリー／6 医療・医薬品／7 精密機器・産業機械製造業／8 医療機器製造業
／9 分析・計測機器／10 電気・電子機器・総合電機／11 半導体・電子部品製造業／12 自動車・輸送・運輸機器・部品製造業／13 鉄鋼・非鉄金属製造業／14 商社・代理店・流通・小売業／15 電力・ガス・石油・その他エネルギー／16 建設・不動産／17 情報・通信／18 金融・投資・コンサルティング／19 シンクタンク／20 水産・農林・鉱業／21 報道・メディア・出版／22 外国公館・機関・団体／23 官公庁・自治体・地方公共団体／24 教育・研究機関／
25 その他

別記様式第2号

極端紫外光研究施設XMC D利用申請書（成果非公開用）

平成 年 月 日

分子科学研究所長 殿

申請者 所属先
所 属 住 所 (〒)
職 名 電 話 (内線)
ふりがな E-mail
氏 名 印 企業種別(*) 大企業 / 中小企業 / その他
分野・業種等(*)
(*) 下段の基準及び一覧より選択すること

下記のとおり貴研究所の装置を有償利用したいので申請します。
また、実施に当たって、万一の傷害等の保障に関しては、申請者と申請者の所属機関においてすべての責任を負えることを誓約します。

記

I 利用する装置 1) X線磁気円二色性測定装置 (XMC D)

II 研究課題

.....

III 研究実験補助のために共同利用研究者を伴う場合、氏名、所属及び職名

氏 名	所 属	職 名	研究の分担事項

IV 使用計画

- ① 使用する光源又はビームライン
- ② 使用希望時期
- ③ 使用希望マシンタイム (1日単位、1日 = 12時間)

V 研究の目的及び従来の研究経過

VI 研究計画

VII 測定試料

- ① 試料名 (化学式)
- ② 形態形状
- ③ 重量
- ④ 安全性
- ⑤ 使用後の処理

VIII 必要とする装置・器具等

- ① 施設にある装置・器具 (数量)
- ② 持込む装置・器具 (数量)
- ③ その他 (寒剤 (液体ヘリウム, 液体窒素) 等)

IX その他

- ① 事前打合せの研究所対応者名
- ② その他特記事項

X 不正防止に関する誓約

申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、以下のガイドライン等を理解し、これらのガイドライン・方針・規程、自身が所属する機関の規則、関連する法令等を遵守し、研究活動における特定不正行為 (捏造、改ざん、盗用)、及びそれ以外の不正行為 (不適切なオーサーシップ、二重投稿等) を行いません。

- (1) 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン
(平成26年8月26日文科科学大臣決定)
- (2) 大学共同利用機関法人自然科学研究機構研究活動上の不正行為を防止するための基本方針
(平成20年2月28日決定)
- (3) 大学共同利用機関法人自然科学研究機構における研究活動上の不正行為への対応に関する規程
(平成20年2月28日自機規程第74号)

以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。

誓約します。

XI 安全管理に関する誓約

申請者及び共同利用研究者は、貴研究所の装置の有償利用にあたり、分子科学研究所安全ガイド (<https://www.ims.ac.jp/guide/safetyguide.pdf>) を理解し、これらのガイドライン、自身が所属する機関の規則、労働安全衛生法等の関連する法令等を遵守し、安全と環境を常に意識しながら、研究活動における事故・災害の発生防止に努めます。

以上について、誓約する場合はチェックを入れてください。

誓約します。

上記の装置利用の申込みを承認する。

所 属：

職 名：

氏 名：

印

上記は、申請者が本研究所に来所し実験等を行うことを承認できる方の所属、職名及び氏名(申請者本人は不可)を記入の上、捺印ください。

記載不要

施設長	担当者

【企業種別基準】

大企業 資本金3億円以上または従業員300人以上のどちらかに該当するもの
中小企業 資本金3億円以上または従業員300人以上のどちらにも該当しないもの
その他 上記に該当しないもの

【分野・業種等一覧】

1 有機材料／2 電子・磁性・金属・無機材料／3 繊維・窯業・紙・パルプ／4 食品・飲料／
5 化粧品・トイレットリー／6 医療・医薬品／7 精密機器・産業機械製造業／8 医療機器製造業
／9 分析・計測機器／10 電気・電子機器・総合電機／11 半導体・電子部品製造業／12 自
動車・輸送・運輸機器・部品製造業／13 鉄鋼・非鉄金属製造業／14 商社・代理店・流通・小売
業／15 電力・ガス・石油・その他エネルギー／16 建設・不動産／17 情報・通信／18 金
融・投資・コンサルティング／19 シンクタンク／20 水産・農林・鉱業／21 報道・メディア・
出版／22 外国公館・機関・団体／23 官公庁・自治体・地方公共団体／24 教育・研究機関／
25 その他

別記様式第3号

極端紫外光研究施設XMC D有償利用許可書

平成 年 月 日

大学共同利用機関法人自然科学研究機構
分子科学研究所長 【公印省略】

下記のとおり、X線磁気円二色性測定装置（XMC D）有償利用を許可します。

記

利用者（申請者）	
利用者所属	
共同利用研究者人数	
研究課題	
課題番号	
利用装置	X線磁気円二色性測定装置（XMC D）
使用日	
使用時間数	
使用料	<p style="text-align: right;">円（消費税込）</p> <p>※別途通知される請求書により納付すること。 （内訳）</p>
許可条件	<p>① 利用に当たっては、善良な管理者の注意をもって当ること。</p> <p>② 第三者に貸与しないこと。</p> <p>③ 実験施設を破損したときは、損害賠償を行うこと。</p> <p>④ その他使用に当たっては、研究所の指示に従うこと。</p>
その他	<p>① 次に掲げる場合は、納付された使用料の全部若しくは一部を返納する。</p> <p style="margin-left: 20px;">1) 申請者の責に帰さない事由又は天災その他により施設利用ができなくなったとき。</p> <p style="margin-left: 20px;">2) 機構の責により、施設利用ができなくなったとき。</p> <p>② 使用に当たり、研究所の指示に従わない場合においては、利用許可を取り消すことができるものとする。</p> <p style="margin-left: 20px;">その場合、使用料は返納しないものとする。</p> <p>③ 利用後は、利用報告書を期限までに提出すること。</p>

別記様式第4号

極端紫外光研究施設XMC D利用報告書（成果非公開用）

平成 年 月 日

分子科学研究所長 殿

報告者 所 属：

氏 名：

印

下記のとおり装置の利用結果を報告します。

記

I 利用した装置 1) X線磁気円二色性測定装置（XMC D）

II 研究課題

III 課題番号

IV 研究実験補助のために共同利用研究者を伴う場合、氏名、所属及び職名

氏 名	所 属	職 名	研究の分担事項

V 利用報告

①利用日時

使用日	使用時間	時間数	備 考
	: ~ :		
	: ~ :		
	: ~ :		

②利用結果（簡潔に）

記載不要

施設長	担当者